

【ナノプローブテクノロジー第 167 委員会】第 95 回研究会

テーマ：SPM の半導体応用に関する新技術

日時：2020 年 11 月 26 日（木）13:00～17:00

開催方式：Webex を用いた web 会議

今回の研究会は、令和世代の半導体応用に関する諸技術を紹介し、将来を展望するために企画しました。ナノ計測技術であるケルビンプローブ力顕微鏡や非線形誘電率顕微鏡の最近の進展、並びに、二次元層状物質の進展について講師の先生方に紹介してもらいます。

プログラム（質疑応答時間を含む）

13:00-13:10 開会挨拶/事務連絡

13:10-13:50 「MH<sub>z</sub> 帯のバイアス電圧を印加可能なヘテロダイン FM-KPFM の開発  
ーバルク状態による表面電位と表面状態による表面電位の分離ー」  
菅原 康弘 (大阪大学工学研究科)

13:50-14:30 「二重バイアス変調静電引力顕微鏡による表面空乏層容量の可変周波数測定」  
高橋 琢二 (東京大学生産技術研究所)

14:30-15:10 「マイクロドームポリマーを用いた二次元層状物質の三次元操作」  
町田 友樹 (東京大学生産技術研究所)

15:10-15:30 休憩

15:30-16:10 「SNDM の半導体応用に関する新技術 ー時間分解 SNDM による界面欠陥  
準位の可視化と絶縁膜付き探針を用いた層状構造半導体の観察ー」  
長 康雄 (東北大学電気通信研究所)

16:10-16:50 「半導体のキャリ濃度計測の ISO 国際標準化の進展  
ー表面準位の影響をどう扱うかー」  
井藤 浩志 (産業技術総合研究所計測標準総合センター)

16:50-17:00 閉会挨拶

企画委員  
大阪大学 菅原 康弘  
キオクシア（株） 臼田 宏治